

噴砂用乾膜

Dry Film Photoresist for Sandblast Process

MS7000 Series

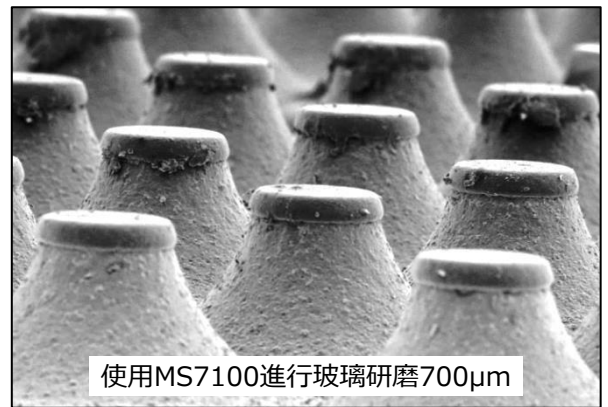
專為噴砂而打造的專用DFR，具有優異的耐磨耗性。

➤ 特徵

- 光固化後，DFR薄膜具有橡膠彈性和非常高的耐磨耗性
- 適用於脆性材料的加工光罩如玻璃、氮化鋁、碳化矽、氧化鋁等基材
- 高分辨率使其適用於所有類型的微加工

➤ 處理條件

型號	MS7100	MS7050
厚度	95 μm	45 μm
曝光量	50-100 mJ/cm^2	50-100 mJ/cm^2
顯影 0.2wt% Na_2CO_3	30°C B.P. 120 sec	30°C B.P. 60 sec
分辨力 Line & Space	100 μm	50 μm



MSAD-H series

高解析、高附著力的噴砂專用DFR。

➤ 特徵

- 適用於小孔徑製程需求
- 可以使用一般的顯影液，幾乎不會留下任何殘膜

➤ 處理條件

型號	MSAD100H	MSAD050H	MSAD030H
厚度	95 μm	50 μm	30 μm
曝光量	50-180 mJ/cm^2	50-180 mJ/cm^2	50-180 mJ/cm^2
顯像 1wt% Na_2CO_3	30°C B.P. 60 sec	30°C B.P. 35 sec	30°C B.P. 25 sec
Line & Space Hole 柱狀口徑 Φ	60 μm 80 μm	40 μm 50 μm	25 μm 30 μm

